Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-095808

(43)Date of publication of application : 04.04.2000

(51)Int.Cl. C08F 4/64 C08F 10/06

The state of the s

(21)Application number : 11-204645 (71)Applicant : IDEMITSU PETROCHEM CO LTD

(22)Date of filing: 19.07.1999 (72)Inventor: KANZAWA MITSUGI

MACHIDA SHUJI TATSUMI FUMIO

(30)Priority

Priority number: 10210104 Priority date: 24.07.1998 Priority country: JP

(54) PRODUCTION OF PROPYLENE-BASED POLYMER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To inexpensively and efficiently produce a polypropylene-based polymer having high melt strain, excellent in moldability and processability and especially suitable for molding of sheet, etc., by (co)polymerizing propylene in the presence of a specific catalyst system.

SOLUTION: Propylene is homopolymerized or copolymerized with a monomer selected from ethylene and a 4–20C α -olefin in the presence of a polymerization catalyst comprising (A) two or more kinds of compounds selected compounds of the group IV of the periodic table having indenyl skeleton and (B) a compound selected from (i) an aluminumoxy compound and (ii) an ionic compound capable of converting to a cation by reacting with the component A to provide the objective polymer in which melt strain MS (g) at 230°C and intrinsic viscosity [η] (dl/g) at 135°C in tetralin satisfy the formula: \log MS23.17× $\log[\eta]$ -0.68 and [η] is 0.1–15 dl/g. A combination, etc., of Hoechst type zirconium complex with Hoechst type hafnium complex is preferable as the component A.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2000-95808 (P2000-95808A)

(43)公開日 平成12年4月4日(2000.4.4)

(51) Int.CL7 COSF 4/64

級別記号

FΪ COSF 4/64 10/06 テーヤコート (参考)

10/06

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 17 頁)

(21)出國番号 特顯平11-204645

(22) ARREIT 平成11年7月19日(1999.7.19)

(31)優先梅主張書号 特額平10-210104 (32) 優先日 平成10年7月24日(1998.7.24)

(33)優先權主張国 日本 (JP)

(71)出庭人 000183657 出光石油化学株式会社

東京都港区芝五丁目6番1号 (72)発明者 神郷 貸

千葉県市原市原南海岸1番油1 (72)発射者 町田 修司

千森県市原市婦崎海岸1番地1 (72) 発明者 巽 富美男

子養県市原市結婚維岸1分集1 (74) 代理人 100678732

弁理士 大谷 保

(54) 【発明の名称】 プロピレン系組合体の製造方法

(57)【夢約】

【課題】 溶融張力が高く、成形加工性に優れ、特に大 帯ブロー成形や厚物発泡体などの成形に好適に用いられ るプロピレン系重合体を、安価に、かつ効率よく製造す る方法を提供すること。

【解決手段】 特定のメタロセン系重合触媒の存在下、* 1 o g M S ≥ 3, 1 7 × 1 o g [n] - 9, 6 8

の関係を満たし、かつ福陽結度 [n] が6.1~15.0 デ

*プロビレンを単独重合またはエチレン及び炭素数4~2 θのαーオレフィンからなる群から選ばれた1種以上の モノマーと共重合させて、温度230℃において測定し た溶融張力MS(g)とテトラリン溶媒中、温度135 *Cにおいて測定した極限結度 (n) (デシリットル/

g) とが、式(I) (I)

シリットル/gのプロピレン系重合体を製造する。

(2) 特開2000-95808 2

「特終精束の範囲】

【請求項1】 (A) インデニル青格を有する周期律表 4 族の遷移金属化台物の中から選ばれた少なくとも二種 と、(B) (B-1) アルミニウムオキシ化合物及び 換しうるイオン性化合物の中から選ばれた少なくとも一 程とを含有してなる重合触媒の存在下、プロピレンを単*

(B-2)上記道移金属化合物と反応してカチオンに変 logMS≥3.17×log(n)-0.68

の関係を満たし、かつ指限粘度 [n] が0.1~15.0 デ シリットル/gの範囲にあるプロビレン系重合体の製造 10 方法。

【請求項2】 重合触媒が、さらに(C)有級アルミニ ウム化合物を含省するものである請求項1記載の製造方※

* 特重合またはエチレン及び炭素数 4 ~ 2 0 の a - オレフ ィンからなる群から選ばれた1種以上のモノマーと共重 合させることを特徴とする、温度230℃において側定 した溶融機力MS(g)とテトラリン溶媒中、温度13 5°Cにおいて測定した極限粘度(n)(デシリットル/ g) とが、式(I)

【請求項3】 (A) 成分の番移金優化合物が (A-1) 一般式(II) [(£1]

ゲン原子、炭素教1~20の炭化水素基又は炭素教1~ 20のハロゲン含有炭化水素基を示し、R'とR'、R * とR*及びR*とR*のうちの少なくとも一個はたが いに結合して環を形成しており、X1 及びX1 はそれぞ れ独立に水素原子、ハロゲン原子又は炭素数1~20の 炭化水素基を示し、Y'は二つの配位子を結合する二価 の架橋基であって、炭素数1~20の炭化水素基、炭素 数1~20のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、ゲ ルマニウム含有基、スズ含有基、-〇-、-СО-、-S-. -SO: -, -Se-, -NR"-, -PR ★30 [作2]

【式中、R*~R*は、それぞれ独立に水素原子、ハロ 20★**-、-P(O)R**-、-BR**-又は-A1R**-を示し、R**は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~2 0の炭化水素基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水 素基を示す。Mⁿ はチタン、ジルコニウム又はハフニウ ムを示す。Jで表される遷移金属化合物、《A-2》上 記一般式/IDにおいて、R'とR'、R'とR'及びR , とR。のいずれの組も環を形成していないインデニル 骨骼を有する運移金属化合物及びそれに対応する4, 5. 6. 7-テトラヒドロインデニル骨格を有する連移 金属化合物、並びに (A-3) 一般式(III)

· · · (III)

〔式中、M⁴ はテタン、ジルコニウム又はハフニウムを 示し、E[®] 及びE[®] はそれぞれ鑑復シクロペンタジエニ ル華、インデニル基、置換インデニル華、ヘテロシクロ ペンタジェニル基、置換ヘテロシクロペンタジエニル 基、アミド基、ホスフィド基、炭化水素基及び珪素含有 40 基の中から選ばれた配位子であって、A'及びA'を介 して架積構造を形成しており、またそれらはたがいに同 一でも異なっていてもよく、X'はσ結合性の配位子を 示し、X'が複数ある場合、複数のX'は同じでも異な っていてもよく、他のX'、E'、E' 又はY' と架橋 していてもよい。Y' はルイス塩基を示し、Y' が複数 ある場合、彼数のY* は同じでも暴なっていてもよく、 他のY', E', E' 又はX'と架橋していてもよく、 A1及びA1は二つの配位子を結合する二価の架橋基で あって、炭素数1~20の炭化水素甚、炭素数1~20 50 である請求項1,2又は3記載の製造方法。

のハロゲン含有炭化水素基、珪素含有基、ゲルマニウム 含荷華、スズ含荷基、-O-、-CO-、-S-、-S O, -, -Se-, -NR''-, -PR"-, -P (O) R**- - BR**-又は-A1R**-を示し、R ***は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水 素基、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基を示 それちはたがいに同一でも異なっていてもよい。q は1~5の整数で [(Mf の原子価) - 2] を示し、r は9~3の整数を示す。〕で寂される遷移金属化合物の 中から選ばれた少なくとも三種である請求項1又は2記 飲の製造方法。

【請求項4】 (A) 成分の選移金属化合物が、チタン 化合物、ジルコニウム化合物及びハフニウム化合物の中 から遊ばれた少なくとも二種の遷移金属が異なる化合物 請求用4記載の製造方法。

ニウム化合物1.0~99.9モル%を含有するものである 【請求項6】 重合触媒として、(A)成分及び(B) 成分の少なくとも一種が損体に固定されてなる損持触媒 を用いる請求項1又は2記載の製造方法。

「職求項7」 プロピレン系章合体のメルトインデック スが、9.005~1000g/10分であり、該重合体 を形成するモノマーがプロビレン70~100をル%と エチレン及び炭素数4~20のα-オレフィンからなる 10 群から選ばれた1種以上のモノマーり~3 0モル%とか らなる請求項1又は2記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はプロビレン系重合体 の製造方法に関し、さらに詳しくは、溶融張力が高く、 成形加工性に優れ、特に大型プロー成形、厚物発泡体、 シートなどの成形に好適に用いられるプロピレン系重合 体を、安価に、かつ効率よく製造する方法に関するもの

100021

【従来の技術】従来、ポリプロピレンは、(1) 剛姓な どの機械的強度が高く、そのバランスに優れる。(2) 化学的に安定で、耐候性に優れ、化学薬品などに侵され にくい。(3) 高融声で耐熱性に優れる。などの特性を 有することから、各種成形体、例えばシート、フィル ム、射出成形体などとして、様々な分野において広く用 いられている。 しかしながら、 このポリプロピレンの利 用分野をさらに拡大するには、押出成形特性の改良が必 慶である。すなわち、ボリプロピレンは、窓融鉀出しの 30 の存在下にプロピレンを単独重合又は他のオレフィン系 際、溶融張力が小さいため、ドローダウンが発生しやす く、大型プロー成形体を製造するには限界があった。ま た、成形体の軽量化、断熱性、制続性などの要求が高ま り、耐熱性を得するボリプロピレン発泡成形体が望まれ ているが、従来のポリプロビレンでは、恣融張力が不足 し、充分に満足しうる発泡成形体を得ることができない のが実状であった。

【0003】ところで、ポリプロピレンの溶融張力を改 良し、溶融加工性を向上させる方法としては、これま で、(1) 溶融張力の高い高分子型の高密度ボリエチレ 40 れた少なくとも一種と、場合により用いられる(C) 有 ンを混合する方法(特闘平6-55868号公報)、 (2) クロム系触媒によって製造される溶融張力の高い 高密度ボリエテレンを混合する方法(特闘平8-924 38号公報)、(3)一般的な高圧ラジカル重合法によ り製造される低密度ボリエチレンを混合する方法 (4)一般的なポリプロビレンに光照射することにより **恣酸張力を高める方法、(5)一般的なポリプロビレン** に架橋削や過酸化物の存在下、光照射することにより溶*

*融張力を高める方法、(6)一般的なポリプロビレンに スチレンなどのラジカル重合性モノマーをグラフトする 方法、(7) プロピレンとポリエンを共重合させる方法 (特勝平5-194778号公報) などが試みられてい

【0004】しかしながら、前記(1)~(3)の方法 においては、溶融張力を高める成分の弾性率、強度、耐 熱性が不足するため、ポリプロピレン本来の特徴が損な われるのを免れない。また、前記(4)及び(5)の方 法においては、副反応として起こる架構反応を制御する ことが困難であって、ゲルの発生により外観不良や機械 特性に悪影響が生じる上 成形加工性を任意に調御する ことに限界があり、制御範囲が狭いという問題がある。 さらに、前記(6)の方法においては、ポリプロビレン の化学的安定性が損なわれ、しかもステレン系のグラフ ト体では樹脂リサイクル性に問題が生じ、また、前記 (7)の方法においては、溶融張力の改良効果が小さ く、充分な効果が発揮されない上、ゲルの発生も懸念さ ns.

20 [0005]

【発明が経決しようとする課題】 本発明は、このような 状況下で、溶融張力が高く、成形加工性に優れ、特にシ ート、大型プロー成形体や厚物発泡体などの成形に好適 に用いられるプロピレン系重合体を 安価に、かつ効率 よく製造する方法を提供することを目的とするものであ

[0006]

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、前記目的 を達成するために鋭意研究を重ねた結果、特定の触媒系 モノマーと共命合させるととにより 冷酔器力と振眠精 度とが特定の関係にあり、かつ特定の極限粘度を有する プロビレン系重合体が得られ、その目的を達成しろるこ とを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて完成し たものである。すなわち、本発明は、(A) インデニル 骨骼を有する周期律表4族の遺移金属化台物の中から選 ばれた少なくとも二種と、(B) (B-1) アルミニウ ムオキシ化合物及び(B-2)上記養物金属化合物と反 応してカチオンに変換しろるイン性化合物の中から選ば 機アルミニウム化合物とを含有してなる重合触媒の存在 下、プロピレンを単独重合またはエチレン及び炭素数4 ~200a-オレフィンからなる群から選ばれた1種以 上のモノマーと共重合させることを特徴とする、温度2 30°Cにおいて測定した溶酔機力MS(c)とテトラリ ン溶媒中、温度135°Cにおいて制定した極限結度 [n] (デシリットル/g) とが、式(i)

1 ogMS≥3.17×1 og (η) -0.68 の関係を満たし、かつ極脚結底(カーが6.1~15.0 デ 50 シリットル/gの範囲にあるプロビレン系重合体の製造

特酬2000-95808

方法を提供するものである。

100071

【発明の実施の影應】本発明の方法においては、重合験 媒として、(A) インデニル骨格を有する周期律表4族 の運移金属化合物の中から選ばれた少なくとも二種と、

(B) (B-1) アルミニウムオキン化合物及び(B-2) 上記番移金属化合物と反応してカチオンに変換しる

るイオン性化合物の中から選ばれた少なくとも一種と、 更に必要により(C)有機アルミニウム化合物とを含有本

[0009] (式中、R1 ~R° は、それぞれ独立に水 素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水素基又 は炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基を示し、R ' とR'、R' とR'及びR'とR'のうちの少なくと X: はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子又は炭素 数1~20の炭化水煮基を示し、Y1 は二つの配位子を 結合する二価の架橋基であって、炭素数1~20の炭化 水素甚、炭素教1~20のハロゲン含有炭化水素基、ほ 素含有基、ゲルマニウム含有基、スズ含有基、-〇-、 -CO-, -S-, -SO2 -, -Se-, -NR "-. -PR"-, -P(O)R"-. -BR"-又は -A1R**-を示し、R**は水素原子、ハロゲン原子、 炭素教1~20の炭化水素草、炭素教1~20のハロゲ ン含有炭化水素草を示す。MP はチタン、ジルコニウム 30 又はハフニウムを示す。〕で表される運移金属化合物で ある.

【0010】との遷移金属化台物は、BASF型譜体と して知られている化合物である。前記一般式 (II) にお いて、R1 ~R0 のうちのハロゲン原子としては、塩 素、臭素、フッ素、ヨウ素原子が挙げられる。炭素数1 ~20の炭化水素基としては、例えばメチル基、エチル 基、n-プロビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、 イソブチル基、tert‐ブチル基、n‐ヘキシル基な どのアルキル苗、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナ フチル基などのアリール量、ベンジル基などのアラルキ ル基などが挙げられ、また敬素数1~20のハロゲン会 有炭化水素基としては、上記炭化水素基の水素原子の1 何以上が適当なハロゲン原子で置換された基が挙げられ る。このR[?] ~R[®] は、たがいに同一であっても異なっ ていてもよく、また、隣接する基、すなわちRっと R* 、R* とR* 及びR* とR* のうちの少なくとも― 組はたがいに結合して環を形成していることが必要であ る。とのうち、立体規則性向上の点から、少なくともR , とR*がたがいに結合して課を形成していることが好 50 (2-メチル-4,5-ベンゾインデニル)ージルコニ

*するものが用いられる。上記(A)成分のインデニル管 格を有する周期律表4族の運移金属化合物の中から選ば れた少なくとも二種としては、例えば下記の(A-1) 成分、(A-2) 成分及び(A-3) 成分の中から選ば れた少なくとも二種を好ましく挙げることができる。 (A-1) 成分: (A-1) 成分は、一般式(II) [8000]

[fb3]

ましい。このような環を形成したインデニル基として は、例えば4、5-ベンゾインデニル基、α-アセナフ トインデニル基及びその炭素数1~10のアルキル電換 体などを挙げることができる。

も一組はたがいに結合して導を形成しており、X*及び 29 【0011】また、X*及びX*のうちハロゲン原子と しては、頻素、臭素、フッ素、ヨウ素原子が挙げられ、 炭素数1~20の炭化水素基としては、例えばメチル 基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基、n-ブチ ル華、1ert-ブチル華、n-ヘキシル基などのアル キル苗、フェニル基などのアリール華、ベンジル基など のアラルキル基などが挙げられる。X¹及びX¹はたが いに同一であっても異なってもよい。一方Y! は二つの 配位子を結合する二価の基であって、そのうちの炭素数 1~20の二価の炭化水素蓋としては、例えばメチレン 基; ジメチルメチレン基; 1、2-エチレン基; ジメチ ル-1,2-エチレン基;1、4-チトラメチレン基; 1、2-シクロプロピレン差などのアルキレン基。ジフ ェニルメチレン基などのアリールアルキレン基などが挙 げられ、炭素数1~20の二価のハロゲン含有炭化水素 基としては、例えばクロロエチレン基、クロロメチレン 基などが挙げられる。また、二価の珪素含有基として は 例えばメチルシリレン葉、ジメチルシリレン葉、ジ エチルシリレン基、ジフェニルシリレン基、メチルフェ ニルシリレン基などが挙げられる。さらに、ゲルマニウ ム合得基、スズ含有基としては、上記珪素含有基におい て、珪素をゲルマニウム、スズに変換した基を挙げるこ とができる。なお、Y*で結合されている二つの配位子 は通常同一であるが、場合により異なっていてもよい。 【0012】 この (A-1) 成分の一般式 (II) で表さ れる遷移金属化合物としては、立体規則性向上の点から ラセミ体であることが好ましく、例えば、特闘平6-1 84179号公報, 特闘平6-345809号公報など に記載されている化合物を挙げることができる。具体例 としては、Facージメチルシランジイルービスー!-

特欄2000-95808

ウムジクロリド、rac‐フェニルメチルシランジイル -ビス-1-(2-メチル-4、5-ベンゾインデニ ルトージルコニウムジクロリド、yac-エタンジイル -ビス-1-(2-メチル-4,5-ベンゾインデニ ル) -ジルコニウムジクロリド、 rac-ブタンジイル -ビス-1-(2-メチル-4,5-ベンゾインデニ ル) -ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシラ ンジイルービス-1-(4.5-ベンゾインデニル)-ジルコニウムジクロリド、Tac - ジメチルシランジイ ルービスー1~(2-メチルーα-メチルーα-アセナ 10 フトインデニル) ージルコニウムジクロリド、rac-フェニルメチルシランジイルービス-1-(2-メチル α-アセナフトインデニル) ージルコニウムジクロリ Fなどのベンゾインデニル型又はアセナフトインデニル 型化合物、及びこれらの化合物におけるジルコニウムを チタン又はハフニウムに置換したものなどを挙げること ができる。このうち、立体郷則性向上の点から、少なく とも2位が置換量であることが好ましい。

(A-2) 成分:

【0013】(A-2)成分は、前記一般式(II)にお 20 いて、R' とR', R' とR'及びR'とR'のいずれ の組も還を形成していないインデニル骨格を有する番祭 金属化台物又はそれに対応する4,5、6,7-テトラ ヒドロインデニル資格を育する遷移金属化合物である。 この遷移金属化合物は、ヘキスト型館体として知られて いる化合物である。この (A-2) 成分の遷移金属化台 物としては、BASF型と同様にラセミ体であることが 好ましく、例えば、特別平4-268308号公報。同 5-306304号公報、同6-100579号公報、 間6-157661号公報、同7-149815号公 報、同7-188318号公報、同7-258321号 公報などに記載されている化合物を挙げることができ

【0014】具体例としては、ジメチルシランジイルー ビス-1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)-ジルコニウムジクロリド、ジメチルシランジイルービス - 1 - [2 - メチルー4 - (1 - ナフチル) インデニ ルトージルコニウムジクロリド、ジメチルシランジイル -ビスー1-(2-エチル-4-フェニルインデニル) ス-1-[2-エチル-4-()-ナフチル) インデニ ル】ジルコニウムジクロリド、フェニルメチルシランジ イル・ビスー1-(2-メチルー4-フェニルインデニ ル) -ジルコニウムジクロリド、フェニルメチルシラン ジィルービスー1ー【2ーメチルー4ー【1ーナフチ ル) インデニル] - ジルコニウムジクロリド、フェニル メチルシランジイルービス-1~ (2~エチル-4-フ ュニルインデニル〉 - ジルコニウムジクロリド、フェニ ルメチルシランジイルーピスー1-[2-エチルー4-(1-ナフチル)インデニル]ージルコニウムジクロリ 50 ニウムジクロリド、racージメチルシリレンービスー

ドなどのアリール置換体、Tac~ジメチルシリレン~ ビスー 1 - (2 - メチル - 4 - エチルインテニル) - ジ ルコニウムジクロリド、Tac - ジメチルシリレンービ スー1~ (2-メチルー4-インプロビルインデニル) ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリレン - ビス-1-(2-メチル-4-第三プチルインデニ ル)ージルコニウムジクロリド、racーフェニルメチ ルシリレンービスー1ー(2-メチル-4-イソプロビ ルインデニル) ージルコニウムジクロリド、Fac-ジ メチルシリレン・ビスー1-(2-エチルー4-メチル インデニル > ージルコニウムジクロリド、Facージメ チルシリレン・ビス・1~(2,4-ジメチルインデニ ル) -ジルコニウムジクロリド、rac-ジメチルシリ レン・ビス・1~(2-メチル・4-エチルインデニ ル) -ジルコニウムジメチルなどの2、4~位置操体。 rac-ジメチルシリレン-ビス-1-(4,7-ジメ チルインデニル) - ジルコニウムジクロリド、rac-1、2-エタンジイルービス-1-(2-メチル-4, 7 - ジメチルインデニル) - ジルコニウムジクロリド。 rac-ジメチルシリレン-ビス-1-(3.4.7-トリメチルインデニル〉ージルコニウムジクロリド、ド ac-1, 2-エタンジイルービス-1-(4, 7-ジ メチルインデニル》ージルコニウムジクロリド、 rac -1、2-ブタンジイルービス-1-(4、7-ジメチ ルインデニル) ージルコニウムジクロリドなどの4、7 -位、2、4、7-位又は3、4,7-位置操体、ジメ チルシランジイルービス-1-(2-メチル-4、6-ジイソプロビルインデニル) -ジルコニウムジクロリ F、フェニルメチルシランジイルーピスー1-(2-メ 30 チルー4, 6-ジイソプロビルインデニル)ージルコニ ウムジクロリド、rac~ジメチルシランジイルービス -1-(2-メチル-4.6-ジイソプロビルインデニ ル) -ジルコニウムジクロリド, rac-1, 2-エタ ンジイルービス・1-(2-メチル-4.6-ジイソブ ロビルインデニル》-ジルコニウムジクロリド、rac ージフェニルシランジイルービス-1-(2-メチルー 4、6-ジイソプロビルインデニル) -ジルコニウムジ クロリド、rac-フェニルメチルシランジイルービス 1 - (2 - メチル - 4、6 - ジイソプロビルインデニ ージルコニウムジクロリド、ジメチルシランジイルービ 46 ル)ージルコニウムジクロリド、Facージメチルシラ ンジイルービス-1-(2、4、6-トリメチルインデ ニル) -ジルコニウムジクロリドなどの2、4、6-位 **磁換体、ドac~ジメチルシランジイルービス-1-**(2.5,6-トリメチルインデニル)ージルコニウム ジクロリドなどの2、5、6-位置換体、rac-ジメ チルンリレン・ビスー (2-メチル-4、5、6、7-テトラヒドロー1ーインデニル) ージルコニウムジクロ リド、rac-エチレン-ビスー (2-メチル-4, 5、6、7-テトラヒドロ-1-インデニル) -ジルコ

(2-メチル-4.5,6,7-テトラヒドロ-1-イ ンデニル》ージルコニウムジメチル、racーエチレン ーピス(2ーメチルー4、5、6、7ーテトラヒドロー 1-インデニル)-ジルコニウムジメチル、rac-エ チレンービスー(4,7-ジメチル-4,5,6,7-テトラヒドロー 1 ーインデニル > ージルコニウムジクロ リドなどの4、5、6、7ーテトラヒドロインデニル化 台物など、及びこれちの化合物におけるジルコニウムをま * チタン又はハフニウムに置換したものなどを挙げること ができる。このうち、立体規則性向上の点から、少なく とも4位が置換器であることが好ましく、少なくとも 4位が置換基であることがさらに好ましい。 (A-3) 成分: (A-3) 成分は、一般式(III) [0015] [(1:4]



【0016】 (式卓、Mi はチタン、ジルコニウム又は ハフニウムを示し、E1及びE1はそれぞれ置換シクロ ベンタジェニル章、インデニル基、置換インデニル基。 ヘテロシクロベンタジェニル基、置換ヘテロシクロベン 々ジェニル基 アミド基 ホスフィド芸、炭化水素基及 び珪素含有基の中から逐ばれた配位子であって、A'及 たがいに同一でも異なっていてもよく、X' はσ結合性 の配位子を示し、X' が複数ある場合、複数のX' は同 ドでも異なっていてもよく、他のX'、E'、E'又は Yi と架橋していてもよい。Yi はルイス塩基を示し、 Y' が複数ある場合、複数のY' は同じでも異なってい てもよく、他のY*, E*、E* 又はX' と架橋してい てもよく、A1及びA1は二つの配位子を結合する二価 の架橋基であって、炭素数1~20の炭化水素量、炭素 数1~20のハロゲン含有炭化水素菌、珪素含有量、ゲ S-. - SO2 -, - Se-, - NR17-, - PR *'-. -P (O) R*'-. -BR*'-Xit-A1R*'-を示し、R**は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~2 0の炭化水素量、炭素数1~20のハロゲン含有炭化水 素量を示し、それらはたがいに同一でも異なっていても よい。qは1~5の整数で〔(M*の原子価)-2]を 示し、「は0~3の整数を示す。」で表される運移金属 (化合物(以下、二重架橋型錦体と称することがある。)

である。 【0017】前記一般式(III) において、M² はチタ ン、ジルコニウム又はハフニウムを示す。E[®]及びE[®] は上述のようにそれぞれ、 置換シクロベンタジエニル 基、インデニル基、置換インデニル基、ヘテロシクロベ ンタジェニル基、置換ヘテロシクロベンタジェニル基。 アミド基 (-N<)、ポスフィド基 (-P<)、炭化水 素差 (>CR-、>C<) 及び珪素含有基 (>SiR -、>S:<)(但し、Rは水素または炭素数1~20 の歳化水素基あるいはヘテロ原子含有差である) の中か ち形成れた配位子を示し、A1及びA1を介して架機棒 造を形成している。また、E! 及びE! はたがいに同一 50 及びA! は、たがいに同一でも異なっていてもよい。こ

でも異なっていてもよい。このE!及びE!としては、 置換シクロペンタジェニル草、インデニル基及び面換イ ンデニル基が好ましい。

[0018]また、X'で示されるの結合性配位子の具 体例としては、ハロゲン原子、炭素数1~20の炭化水 来華 総支数1~20のアルコキシ基、総表数6~20 びA' を介して架橋構造を形成しており、またそれらは 20 のアリールオキン基、炭素数1~20のアミド基、炭素 数1~20の注素含有基、炭素数1~20のホスフィド 基、炭素数1~20のスルフィド基、炭素数1~20の アンル基などが挙げられる。このX³が複数ある場合、 複数のX'は同じでも異なっていてもよく、他のX'。 E1 . E1 又はY1 と架橋していてもよい。一方、Y1 で示されるルイス爆基の具体例としては、アミン類、エ ーテル類、ホスフィン類、チオエーテル類などを挙げる ことができる。このY*が複数ある場合、複数のY*は 同じでも異なっていてもよく、他のY'やE'、E'又 ルマニウム含得基、スズ含有基、-〇-、-CO-、- 30 はX'と架橋していてもよい。次に、A'及びA'で示 される架舗基のうち、少なくとも一つは炭素数1以上の 炭化水素基からなる架橋基であることが好ましい。この よろな架橋基としては、例えば一般式 [0019]

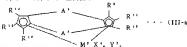
> [ft5] $C \longrightarrow C$

46 【0020】(R'及びR"はそれぞれ水素原子又は炭 素数1~20の炭化水素基で、それらはたがいに同一で も異なっていてもよく、またたがいに結合して環構造を 形成していてもよい。eは1~4の整数を示す。) で表 されるものが挙げられ、その具体例としては、メテレン 基、エチレン基、エチリデン基、プロビリデン基、イソ プロビリデン基、シクロヘキシリデン基、1,2-シク ロヘキシレン基、ビニリデン基 (CH₂ = C=) などを 挙げることができる。これらの中で、メチレン基、エチ レン意及びイソプロビリデン基が好適である。このA1

(7) 特開2000-95808 金属化合物の中では、一般式(III-a)

*あってもよい。このような一般式(III) で表される遷移

11 の一般式(III) で表される運移金属化合物において、E 1 及びE 1 が置換シクロベンタジェニル基, インデニル 基又は置換インデニル基である場合、A1及びA1の架 橋盖の結合は、(1,1')(2,2')二重架橋型で あってもよく、(1, 2')(2, 1')二重架模型で*



[0021]

[(b6)

【0022】で表される二重架構型ピスシクロベンタジ エニル誘導体を配位子とする遷移金属化台物が好まし い。上記一般式(III-a) において、M'、A'、 A^{1} 、 q及びrは上記と同じである。 X^{1} は σ 結合性の 配位子を示し、X1 が複数ある場合、複数のX1 は同じ でも異なっていてもよく、他のX*又はY*と架橋して いてもよい。このX1の具体例としては、一般式(III) のX¹の説明で例示したものと同じものを挙げることが できる。Y' はルイス塩基を示し、Y' が複数ある場 台、複数のY'は同じでも異なっていてもよく、他のY , 又はX1 と架橋していてもよい。このY1の具体例と しては、一般式(III) のY'の説明で例示したものと同 じものを挙げることができる。R"~R"はそれぞれ水 素原子, ハロゲン原子, 炭素数1~20の炭化水素基, 炭素数1~20のハロゲン含有炭化水素基, 珪素含有基 又はヘテロ原子含有基を示すが、その少なくとも一つは 水素原子でないことが必要である。また、R*~R*は たがいに同一でも異なっていてもよく、隣接する基同士 がたがいに結合して環を形成していてもよい。 【0023】との二重架模型ビスシクロペンタジエニル 誘導体を配位子とする遷移金属化合物は、配位子が (1、1) (2、2) 二重架橋型及び(1、2)

(2、1) 二重架橋型のいずれであってもよい。この 一般式(EII) で表される運移金属化合物の具体例として は、(1, 1'-エチレン)(2, 2'-エチレン)-ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、(1. 2' -エチレン) (2, 1' -エチレン) -ビス(イン デニル) ジルコニウムジクロリド、(1、1 -メチレ ン) (2, 2' -メチレン) -ビス(インデニル)ジル 40 コニウムジクロリド、(1、2 -メチレン)(2, 1 - メチレン) - ビス (インデニル) ジルコニウムジ クロリド、(1、1'-イソプロピリデン)(2、2' イソプロピリデン》 - ピス(インデニル)ジルコニウ ムジクロリド、(1、2'-イソプロビリデン)(2、 1' - イソプロビリデン) - ビス (インデニル) ジルコ ニウムジクロリド、 (1、1'-エチレン) (2、2' エチレン) -ビス(3-メチルインデニル)ジルコニ ウムジクロリド、(1,2'-エチレン)(2,1'-

ムジクロリド、(1, 1'-エチレン)(2,2'-エ チレン) - ビス(4、5 - ベンゾインデニル) ジルコニ ウムジクロリド、(1,2'-エチレン)(2,1'-エチレン) - ビス(4、5 - ベンゾインデニル) ジルコ ニウムジクロリド。(1、1'-エチレン)(2、2' -エチレン)-ビス(4-イソプロビルインデニル)ジ ルコニウムジクロリド、(1,2"-エチレン)(2, 1'-エチレン)-ビス(4-イソプロピルインデニ 29 ル)ジルコニウムジクロリド。(1、1 - エチレン) (2.2 - エチレン) - ビス(5,6-ジメチルイン デニル) ジルコニウムジクロリド、(1.2 -エチレ ン) (2, 1'-エチレン)-ビス(5,6-ジメチル インデニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-エ チレン) (2、2°-エチレン) - ビス (4, 7-ジイ ソプロビルインデニル)ジルコニウムジクロリド。 (1, 2'-エチレン)(2, 1'-エチレン)-ビス (4、7-ジイソプロビルインデニル)ジルコニウムジ クロリド、(1, 1 - エチレン) (2, 2 - エチレ 39 ン) -ビス (4-フェニルインデニル) ジルコニウムジ クロリド、(1、2°-エチレン)(2,1°-エチレ ン) - ビス (4 - フェニルインデニル) ジルコニウムジ クロリド、(1,1'-エチレン)(2,2'-エチレ ン) -ビス(3-メチル-4-イソプロビルインデニ ル) ジルコニウムジクロリド。(1,2" -エチレン) (2、1 -エチレン) - ビス (3-メチル-4-イン プロビルインデニル)ジルコニウムジクロリド、(1) 1' - エチレン) (2, 2' - エチレン) - ビス(5, 6-ベンゾインデニル) ジルコニウムジクロリド、 (1, 2'-エチレン)(2, 1'-エチレン)-ビス (5.6-ベンゾインデニル) ジルコニウムジクロリ F. (1, 1'-エチレン) (2, 2'-イソプロピリ デン) -ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド, (1, 2 - エチレン) (2, 1 - イソプロビリテ ン) - ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、 (1、1 - イソプロピリデン) (2、2 - エチレ ン) -ビス(インデニル)ジルコニウムジクロリド, {1, 2 - メチレン} (2, 1 - エチレン) - ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリド、(1.1'-エチレン) - ビス (3 - メチルインデニル) ジルコニウ 50 メチレン) (2、2 - エチレン) - ビス (インデニ

(8)

ル) ジルコニウムジクロリド、 (1、1 - エチレン) (2、2 ーメチレン) ービス (インデニル) ジルコニ ウムジクロリド、 {1, 1'ーメチレン} {2, 2'-イソプロピリデン) - ビス (インデニル) ジルコニウム ジクロリド、(1,2'-メチレン)(2,1'-イソ プロビリデン) -ビス (インデニル) ジルコニウムジク ロリド、(1, 1'-イソプロピリデン)(2, 2'-メチレン) -ビス (インデニル) ジルコニウムジクロリ F. (1, 1'-メチレン) (2, 2'-メチレン) (3-メチルシクロベンタジェニル) (シクロベンタジ 19 ビリデン) -ビス(3,4-ジメチルシクロベンタジェ エニル》ジルコニウムジクロリド。(1.1 - イソブ ロビリデン)(2,2 - イソプロビリデン)(3-メ チルシクロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-プロピリデン) (2、2 -プロビリデン) (3-メテルシクロベンタ ジエニル》 (シクロペンタジエニル) ジルコニウムジク ロリド、(1、1'-エテレン)(2、2'-メテレ ン) - ビス (3 - メチルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムジクロリド、(1、1'-メチレン)(2、2' -エチレン) - ビス (3 - メチルシクロペンタジエニ ル)ジルコニウムジクロリド、(1、1 - イソプロピ リデン》(2、2 -エチレン)-ビス(3-メチルシ クロベンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、(). 1'-エチレン) {2,2'-イップロピリデン)-ビ ス(3-メチルンクロベンタジエニル)ジルコニウムジ クロリド、(1、1°-メチレン)(2,2°-メチレ ン) - ビス (3 - メチルシクロペンタジエニル) ジルコ ニウムジクロリド、(1、1'-メチレン)(2、2' -イソプロピリデン》-ビス(3-メチルシクロベンタ ジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 1、-イソ 30 体) の中から選ばれた少なくとも二種が用いられるが、 プロビリデン) (2、2、-イソプロビリデン) -ビス (3-メチルシクロベンタジェニル) ジルコニウムジク ロリド、(1、1'-エチレン)(2、2'-メチレ ン) - ビス (3、4 - ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1、1'-エチレン) (2、2 - イソプロピリデン) - ビス(3,4-ジメ チルシクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロリド。 (1、1 ーメチレン) (2, 2 ーメチレン) ービス (3、4-ジメチルシクロペンタジエニル) ジルコニウ ムジクロリド、(1,1'-メチレン)(2,2'-イ 40 機型ハフニウム循体、ヘキスト型ジルコニウム循体-二 ソプロピリデン) -ビス(3,4-ジメチルシクロペン タジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,1'-イ ソプロビリデン) (2, 2'-イソプロビリデン)-ビ ス(3,4-ジメチルシクロベンタジエニル)ジルコニ ウムジクロリド、 (1, 2 ーエチレン) (2, 1 ー メチレン) -ビス (3-メチルシクロベンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2"-エチレン) (2, 1 - イソプロピリデン) - ビス(3-メチルシ クロベンタジエニル)ジルコニウムジクロリド、(1,

14 メチルシクロベンタジエニル) ジルコニウムジクロリ F. (1, 2' -メチレン) {2, 1' ~イソプロビリ デン) ーピス (3ーメチルシクロペンタジェニル) ジル コニウムジクロリド、 (1、2 - イソプロビリデン) (2、1 - イソプロビリデン) - ビス(3-メチルシ クロベンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1, 2' -エチレン) (2, 1' -メチレン) -ビス(3, 4-ジメチルシクロペンタジエエル) ジルコニウムジク ロリド、(1、2°-エチレン)(2、1°-イソプロ ニル)ジルコニウムジクロリド。(1、2 ーメチレ ン) (2, 1'-メチレン)-ビス(3, 4-ジメチル シクロペンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、 (1, 2 ーメチレン) (2, 1 ーイソプロビリデ ン) -ビス (3、4-ジメチルシクロベンタジエニル) ジルコニウムジクロリド、(1,2"-イソプロビリデ ン) (2, 1'-イソプロビリデン)-ビス(3, 4-ジメチルシクロベンタジエニル) ジルコニウムジクロリ F、(1, 2' -ジメチルシリレン)(2, 1' -ジメ 20 チルシリレン) ビスインデニルジルコニウムジクロリド など及びこれらの化合物におけるジルコニウムをチタン 又はハフニウムに置換したものを挙げることができる。 もちろんこれらに限定されるものではない。また、他の 族又はランタノイド系列の金属元素の類似化合物であっ てもよい。

【0024】本発明における重合無線においては、 (A) 成分の運移金属化合物として、好ましくは、前記 (A-1) 成分(BASF型錯体), (A-2) 成分 《ヘキスト型雑体》及び(A-3)成分 (二重架模型器 この場合、特に、ジルコニウム化合物と他の遷移金属化 合物との組み合わせが好適であり、ジルコニウム化合物 とハフニウム化合物の組合せがさらに好適である。 【9925】とのような組合わせの好適な例としては、 ヘキスト型ジルコニウム循体-ヘキスト型ハフニウム錯 体、BASF型ジルコニウム錯体-BASF型ハフニウ ム語体、ヘキスト型ジルコニウム錯体-BASF型ハフ ニウム錯体、BASF型ジルコニウム結体-ヘキスト型 ハフニウム錯体、BASF型ジルコニウム錯体-二重架 重架機型ハフニウム錯体、二重架機型ジルコニウム錯体 -二重架綺型ハフニウム館体, 二重架模型ジルコニウム 錯体-BASF型ハフニウム無線, 二重架縮型ジルコニ ウム循体ーヘキスト型ハフニウム錯体などが挙げられ

【0026】(A) 成分の遷移金属化合物として、ジル コニウム化合物と他の遷移金属化合物との組合わせを用 いた場合、複合運移金属化合物中のジルコニウム化合物 の含有量は、好ましく1.0~99.9モル%、より好まし 2'-メチレン) (2, 1'-メチレン)-ビス(3- 50 くは5.0~99.0モル%, さちに好ましくは25.0~9

5.0モル%,特に好ましくは55.0~95.0モル%の範 間である。本発明における重合触媒においては、(B) 成分として、(B-1)アルミニウムオキシ化合物及び

(B-2) 前記選移金属化合物と反応してカチオンに変 換しうるイオン性化台物の中から選ばれた少なくとも一本

* 橙が用いられる。上記 (B-1) 成分のアルミニウムオ キシ化合物としては、一般式(IV) [0027] [ft?]

$$\frac{R^{16}}{R^{16}} A = 0 \longrightarrow \frac{A}{R} = 0 \longrightarrow \frac{A}{R^{16}} A = 0 \longrightarrow \frac{R^{16}}{R^{16}} \cdots (10)$$

【0028】(式中、R**は炭素数1~20、好ましく 10%も異なっていてもよい。)で示される鎖状アルミノキサ は1~12のアルキル基、アルケニル基、アリール基、 アリールアルキル基などの炭化水素量あるいはハロゲン 原子を示し、wは平均重合度を示し、適常2~50、好 ましくは2~40の整数である。なお、各R**は同じで※

ン. 及び一般式 (V)

[0029] [4k8]

[0030] (式中、R**及びwは前紀一般式 (IVA に サンを挙げることができる。前記アルミノキサンの製造 法としては、アルキルアルミニウムと水などの宿合剤と を接触させる方法が挙げられるが、その手段については 特に限定はなく 公知の方法に進じて反応させればよ い。例えば、①有機アルミニウム化合物を有機溶剤に溶 **嫁しておき、これを水と接触させる方法、②重合時に当** 初有機アルミニウム化合物を加えておき、後に水を添加 する方法、②金属組などに含有されている結晶水、無機 物や有機物への吸着水を有機アルミニウム化合物と反応★

(ただし、L' はM' 、R''R"M',R", C又はR" M'である。) (VI)、(VII)式中、L³ はルイス塩差、【2】 は、 非配位性アニオン (2*) 又は (2*) ここで (21) は複数の基が元素に結合したアニオン、すな わち (M' G' G' ···G') (ととで、M' は関類 律表第5~15族元素、好ましくは周期律表第13~1 5 族元素を示す。G'~G'はそれぞれ水素原子、ハロ 0のジアルキルアミノ基、炭素数1~20のアルコキシ 基、炭素数6~20のアリール基、炭素数6~20のア リールオキシ華、脚素数7~40のアルキルアリール 基、炭素数7~40のアリールアルキル基、炭素数1~ 20のハロゲン関係炭化水素基、炭素数1~20のアシ ルオキシ基、有機メタロイド基、又は炭素数2~20の ヘテロ原子含有炭化水素基を示す。G1 ~Gf のうち2 つ以上が環を形成していてもよい。 f は [(中心金属M ¹ の原子価) + 1] の整数を示す。) (2 °) 'は、

★させる方法、@テトラアルキルジアルミノキサンにトリ おけるものと同じである。)で示される環状アルミノキ 20 アルキルアルミニウムを反応させ、さらに水を反応させ る方法などがある。なお、アルミノキサンとしては、ト ルエン不溶性のものであってもよい。

> 【0031】これらのアルミニウムオキシ化合物は一種 用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。 一方 (B-2)成分としては、剪記資移金属化合物と 反応してカチオンに変換しうるイオン性化合物であれ は、いずれのものでも使用できるが、特に効率的に重合 活性点を形成できるなどの点から、次の一般式(VI)。 (VII)

ンステッド酸単独又はブレンステッド酸及びルイス酸の 組合わせの共役塩基 あるいは一般的に韶強勝と定義さ れる共役塩基を示す。また、ルイス塩基が配位していて もよい。また、R**は水素原子、炭素数1~20のアル キル華、炭素数6~20のアリール華、アルキルアリー ル華又はアリールアルキル葉を示し R**及びR**はそ れぞれシクロベンタジエニル基、蓄物シクロベンタジエ ニル華、インデニル基又はフルオレニル基、R¹⁹は炭素 ゲン原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数2~4 40 数1~20のアルキル基、アリール基、アルキルアリー ル華又はアリールアルキル華を示す。R**はテトラフェ ニルボルフィリン、フタロシアニンなどの大環状配位子 を示す。hは〔L'-R')、〔L')のイオン価数で 1~3の整数。aは1以上の整数、b=(h×a)であ る。M* は、周期律表第1~3、11~13、17 終元 意を含むものであり、MP は、周期律表第7~12 終元 素を示す。〕で表されるものを好適に使用することがで **きる**。

【0032】 ことで、L1 の具体例としては、アンモニ 酸解能定数の遊数の対数 (pK,) が-10以下のブレ 50 ア、メチルアミン、アニリン、ジメチルアミン、ジエチ ルアミン、Nーメチルアニリン、ジフェニルアミン、 N. Nージメチルアニリン、トリメチルアミン、トリエ チルアミン。トリーロープテルアミン、メチルジフェニ ルアミン、ピリジン、p-プロモーN、N-ジメチルア ニリン、p-ニトローN、N-ジメチルアニリンなどの アミン類、トリエチルホスフィン、トリフェニルホスフ ィン、ジフェニルホスフィンなどのホスフィン類。テト ラヒドロチオフェンなどのチオエーテル類、安息香酸エ チルなどのエステル類、アセトニトリル、ベンゾニトリ ルなどのニトリル類などを挙げることができる。

【0033】R10の具体例としては水素、メチル量、エ チル甚、ベンジル基、トリチル基などを挙げることがで き、R**。R**の具体例としては、シクロペンタジェニ ル甚 メチルシクロペンタジエニル芸 エチルシクロペ ンタジェニル芸、ペンタメチルシクロペンタジエニル基 などを挙げることができる。R門の具体例としては、フ ェニル基、p~トリル基、p-メトキンフェニル基など を挙げることができ、Rioの具体例としてはテトラフェ ニルポルフィン、フタロシアニン、アリル、メタリルな どを挙げることができる。また、M°の具体例として it. L., Na, K. Ag, Cu, Br. I. I. to を挙げることができ、M'の具体例としては、Mn、F e、Co、Ní、Znなどを挙げることができる。 [0034]また、[21] * 、すなわち[M' G' G

' · · · G'] において、M' の具体例としてはB、A !. S1. P. As, Sbなど、好ましくはB及びAI が挙げられる。また、G1 、G1 ~G1 の具体例として は、ジアルキルアミン基としてジメチルアミン華、ジエ チルアミノ基など、アルコキシ基若しくはアリールオキ シ苗としてメトキシ基、エトキシ基、n-ブトキシ基、 フェノキシ基など、炭化水素基としてメチル基。エチル 基、n-プロビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、 イソプチル基。n-オクチル基。n-エイコシル基。フ ェニル基、p-トリル基、ベンジル基、4-1-ブチル フェニル基、3、5ージメチルフェニル基など、ハロゲ ン原子としてフッ素、塩素、臭素、ヨウ素、ヘテロ原子 含有炭化水素基としてローフルオロフェニル基。3、5 - ジフルオロフェニル基、ベンタクロロフェニル基、 3、4、5 - トリフルオロフェニル基、ペンタフルオロ フェニル基,3、5ービス(トリフルオロメチル)フェ ニル苺、ビス(トリメチルシリル)メチル基など、有機 メタロイド基としてペンタメチルアンチモン基。トリメ チルシリル基、トリメチルゲルミル基、ジフェニルアル シン基、ジシクロヘキシルアンチモン基。ジフェニル調 素などが挙げられる。

【0035】また、非配位性のアニオンすなわちpKa が-10以下のプレンステッド酸単独又はプレンステッ ド酸及びルイス酸の組合わせの共役塩基 [2]) の具 体例としてはトリフルオロメタンスルホン酸アニオン (CF, SO,) * , ビス(トリフルオロメタンスルホ 50 エル) 減酸ジメチルアニリニウム, テトラフェニル調酸

ニル) メチルアニオン、ビス (トリフルオロメタンスル ホニル) ベンジルアニオン、ビス (トリフルオロメタン スルホニル) アミド、過塩素酸アニオン (CI O。) * , トリフルオロ酢酸アニオン(CF CF C

O.) 、ヘキサフルオロアンチモンアニオン(SbFa) * 、フルオロスルホン酸アニオン (FSO,)* 、クロ ロスルホン酸アニオン (CISO,) · 、フルオロスル 水ン酸アニオンノ5-フッ化アンチモン(FSO、/S bF、) · 、フルオロスルホン酸アニオン/5-フッ化 10 砒素 (FSO, /AsF,) · , トリフルオロメタンス ルホン酸/5-フッ化アンチモン (CF,SO, /Sb

F。) などを挙げることができる。 【0036】とのような(B-2)成分化合物の具体例 としては、テトラフェニル研防トリエチルアンモニウ ム、テトラフェニル調酸トリーローブチルアンモニウ ム. テトラフェニル調整トリメチルアンモニウム. テト ラフェニル調酸テトラエチルアンモニウム、テトラフェ ニル硼酸メチル (トリーローブチル) アンモニウム、デ トラフェニル衝酸ベンジル (トリーn-ブチル) アンモ ニウム、テトラフェニル硼酸ジメチルジフェニルアンモ ニウム、テトラフェニル硼酸トリフェニル (メチル) ア ンモニウム、テトラフェニル調酸トリメチルアニリニウ ム、テトラフェニル領徴メチルピリジニウム、テトラフ ェニル調酸ベンジルビリジニウム、テトラフェニル调酸 メチル (2-シアノビリジニウム)、テトラキス (ベン タフルオロフェニル〉調験トリエチルアンモニウム、テ トラキス (ペンタフルオロフェニル) 副跨トリーローブ チルアンモニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) 翻鎖トリフェニルアンモニウム、テトラキス (ペン 36 タフルオロフェニル) 過酸テトラーカープチルアンモニ ウム、テトラキス (ペンタブルオロフェニル) 顕彰テト ラエチルアンモニウム, テトラキス (ベンタフルオロフ ェニル) 運酸ベンジル (トリーロープチル) アンモニウ ム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 磺酸メチル ジフェニルアンモニウム、テトラキス (ペンタフルオロ フェニル) 調酸トリフェニル (メチル) アンモニウム、 テトラキス (ベンタフルオロフェニル) 調酸メチルアニ リニウム、テトラキス (ベンタフルオロフェニル) 調敵 ジメチルアニリニウム、テトラキス (ベンタフルオロフ 49 ェニル) 調散トリメチルアニリニウム、テトラキス(ペ ンタフルオロフェニル) 硼酸メチルビリジニウム、テト ラキス (ペンタフルオロフェニル) 顔酸ペンジルビリジ ニウム,テトラキス (ベンタフルオロフェニル) 硼酸メ チル (2-シアノビリジニウム), テトラキス (ベンタ フルオロフェニル) 調磁ベンジル (2-シアノビリジニ ウム)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 御盥メ チル(4-シアノビリジニウム)、テトラキス(ベンタ フルオロフェニル〉磺酸トリフェニルホスホニウム。テ

トラキス (ビス (3、5 - ジトリフルオロメチル) フェ

フェロセニウム、テトラフェニル硼酸銀。テトラフェニ ル御館トリチル、テトラフェニル御館テトラフェニルボ ルフィリンマンガン、テトラキス(ベンタフルオロフェ ニル) 調酸フェロセニウム、テトラキス (ベンタフルオ ロフェニル) 硼酸(1,1'-ジメチルフェロセニウ ム)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) 硼酸デカ メチルフェロセニウム、テトラキス (ペンタフルオロフ ェニル) 補酬額 テトラキス (ペンタブルオロフェニ ル) 顕融トリチル、テトラキス (ベンタフルオロフェニ ル) 硼酸リチウム、テトラキス (ベンタフルオロフェニ 19 ル) 硼酸ナトリウム、テトラキス (ベンタフルオロフェ ニル) 調酸テトラフェニルポルフィリンマンガン、テト ラフルオロ運能線、ヘキサブルオロ維軽線 ヘキサフル オロ研索階級、高海索酔線、トリフルオロ酢酸線、トリ フルオロメタンスルホン酸銀などを挙げることができ ъ.

19

[0037]での(B-2)成分である。錠(A)成分の理修金組化合物と反応してカチン化交換し入るイオン性化合物は一種別いてもよく、また二種以上を組み合わせて用いてもよい。本先別における最高機様において 20 (B) 級分として、C (B-1) 成分のみを用いてもよく、また、 (B-1) 成分のみを用いてもよく、また、 (B-1) 成分のようせて用いてもよい。まちに、非常所における配金機構は、関配の(A) 成分入び(B) 成分を振り入して含含するものであってもよいし、また、(A) 成分、(B) 成分交近(C) 有機アルミニウム化合物を主張分として含有するものであってもよいし、また、(A) 成分、(B) 成分交近(C) 有機アルミニウム化合物を主張分として含有するものであってもよいし、また、(A) 成分、(B) 成分をなってもよいし、また、(A) 成分、(B) 成分をするものであってもよいし、また、(A) 成分、(B) 成分をなってもよいも、また。(A) 成分、(B) 成分をなってもないもない。

【0038】ととで、(C) 成分の有様アルミニウム化合物としては、一般式 (VIII)

R11 A LQ. (VIII)

(式中、民"は就要数1、~10のアルキル基、Qは水業 原子、脱素数1、~20のアルコキシ基、炭素数6、~20 のアリール基又はハロゲン原子を示し、Vは1~3の登 数である)で示される化合物の場けられる。前記一般式 (VIII) で示される化合物の場けをしては、トリメテ ルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブ ロビルアルミニウム、トリインアチルアルミニウム、ジ メチルアルミニウムとフロリド、ジェチルアルミニウム。 ロリド、メチルアルミニウムシウロリド、ジェチルアルミ シウムジラロリド、ジメチルアルミニウムシウロリド、ジェチルアルミニウムとドリド、エチルアルミニウムとアーリン・メチルアルミニウムとアトリド、エチルアルミニウムとスキクロリド等が 参げられる。これらの再模アルミニウムとい。 (回り3)日、ごの金金台域における(A) 陸域成分と 「回り3日」での金金台域における(A) 陸域成分と

(B) 無線成分との使用割合は、(B) 無線成分として (B-1) 化合物を用いた場合には、モル比で好ましく は1:1-1:10°、より好ましくは1:10~1: 10°の発限が望ましく、上記発問を追続する場合は、

単位重量ポリマーあたりの触媒コストが高くなり 専用 的でない。また (B-2) 化合物を用いた場合には、モ ル比で好ましくは10:1~1;100、より好ましく は2:1~1:10の範囲が望ましい。この範囲を逸脱 する場合は単位重量ポリマーあたりの触媒コストが高く なり、実用的でない。また、(A) 触媒成分と所望によ り用いちれる (C) 無媒成分との使用割合は、モル比で 好ましくは1:1~1:20000 より好きしくは 1:5~1:2000、さちに好ましくは1:10~ 1:1000の範囲が禁ました。該(C) 輪線成分を用 いることにより、連移金属当たりの重合活性を向上させ ることができるが、あまり多い場合、特に上記範囲を逃 除する場合は資格アルミニウム化合物が無駄になるとと もに 宣合体中に多番に発存し、また少ない場合は充分 な触媒活性が得られず、好ましくない場合がある。 【0040】本発明においては、各触媒成分の少なくと も一種を適当な担体に担持して用いることができる。該 担体の提繋については特に制限はなく、無機膨化物担 体。それ以外の無機担体及び有機担体のいずれも用いる ととができるが、特にモルホロジー副列の占から無機融 化物担体あるいはそれ以外の無機担体が好ましい。無機 酸化物担体としては、具体的には、SiO,、Al, O , . MgO, ZrO, , TiO, , Fe, O, . B, O 」、CaO, ZnO, BaO, ThO, やこれらの複合 物。倒えばシリカアルミナ、ゼオライト、フェライト、 グラスファイバーなどが挙げられる。これらの中では、 特にSIO、またはAI、O、が好ましい。なお、上記 無機酸化物相体は、少量の炭酸塩、硝酸塩、硫酸塩など を含有してもよい。

36 【0041】一方、上記以外の担体として、MgC 1。. Mic (OC、H.)。などのマグネシウム化合物な どで代表される一般式MgR"、X', で表されるマグ ネシウム化合物やその錯塩などを挙げることができる。 ことで、R**は炭素数1~20のアルキル基、炭素数1 ~20のアルコキシ基又は炭素数6~20のアリール 基、X'はハロゲン原子又は炭素数1~20のアルキル 基を示し、xは0~2、yは0~2であり、かつx+y = 2 である。 AR" 及びAX' はそれぞれ同一でもよ く、また雲なってもいてもよい。また、有機担体として は、ポリスチレン、スチレンージビニルベンゼン共重合 体、ポリエチレン、ポリプロピレン、蜜漿ポリステレ ン、ポリアリレートなどの重合体やスターチ、カーボン などを挙げるととができる。本発明において用いられる 担体としては、MgC!2、MgCl(OC, Hs)、 Mg (OC, H_c), SiO, Al, O, などが好ま しい、また相体の幹状は、その種類及び製柱により量な るが、平均粒径は通常1~300μm、好ましくは10 ~200 mm. より好ましくは20~100 mmであ る。粒経が小さいと重合体中の微粉が増大し、粒径が大 50 きいと重合体中の租大粒子が増大し嵩密度の低下やホッ

特開2000-95808 (12)

21 パーの結まりの原因になる。また、担体の比表面積は、 通常1~1000m* /g. 好ましくは50~500m * /g、細孔容績は通常の.1~5 cm3 /g、好ましく

は0.3~3 cm' /gである。 【0042】比表面積又は細孔容積のいずれかが上記範 間を追脱すると、触媒活性が低下することがある。な お、比表面積及び細孔容積は、例えばBET法に従って

- 吸着された窒素ガスの体積から求めることができる (J. Am. Chem. Soc. 第60巻、第309ペ ージ(1983年)参照)。さらに、上記担体は、通常 16 150~1000℃、好ましくは200~800℃で焼 成して用いることが望ましい。触媒成分の少なくとも一 継を確記相体に指待させる場合。(A) 触線成分及び (B) 鮟鱇成分の少なくとも一方を、好ましくは(A)
- 無媒成分及び(B) 無螺成分の両方を狙締させるのが、 モルホロジー制御、気相重合などプロセスへの適用性な どの点から望ましい。
- 【0043】 該担体に、(A) 成分及び(B) 成分の少 なくとも一方を担待させる方法については、特に制限さ れないが、例えばO (A) 成分及び(B) 成分の少なく 20 とも一方と担体とを混合する方法、の資体を有機アルミ ニウム化台物又はハロゲン含有ケイ素化合物で処理した のち、不活性溶媒中で(A)成分及び(B)成分の少な くとも一方と混合する方法。 ②担体と(A) 成分又は (B) 成分あるいはその両方と有機アルミニウム化合物 又はハロゲン含有ケイ素化合物とを反応させる方法、の (A) 成分又は(B) 成分を担体に担持させたのち、
- (B) 成分又は(A) 成分と混合する方法、〇(A) 成 分と(B)成分との接触反応物を担体と混合する方法、 め(A) 成分と(B) 成分との接触反応に関して、損体 30 を共存させる方法などを用いることができる。なお、上 記の の及びのの反応において、(C)成分の有様アル ミニウム化合物を添加することもできる。 【0044】このようにして得られた触媒は、いったん
- 溶媒留去を行って固体として取り出してから重合に用い てもよく、そのまま重合に用いてもよい。また、本発明 においては、(A) 成分及び(B) 成分の少なくとも-方の組体への組持操作を重合系内で行うことにより触媒 を生成させることができる。例えば(A)成分及び (B) 成分の少なくとも一方と担体とさらに必要により 40
- 前記(C) 成分の有機アルミニウム化合物を加え、プロ ビレンを掌圧~20kg/emi 加えて、-20~20 ()*Cで1分~2時間程度予備重合を行い無媒粒子を生成 させる方法を用いることができる。
- 【0045】本発明においては、前記化合物(B-1) 成分と担体との使用割合は、重置比で好ましくは1:0、 5~1:1000、より好ましくは1:1~1:50と するのが望ましく、(B-2)成分と担体との使用割合 は、重量比で好ましくは1:5~1:10000、より 好ましくは1:10~1:500とするのが望ましい。 50 ビレンとコモノマーとの共重合体の構造としては、ラン

触媒成分(B)として二種以上を複合して用いる場合 は A(B)成分と担体との使用割合が倉骨比で上記範 間内にあることが望ましい。また、(A)成分と组体と の使用割合は、重量比で、好ましくは1:5~1:10 000、より好ましくは1:10~1:500とするの が望ましい。

[0046] 該(B) 成分[(B-1) 成分. (B-2) 成分] と組体との使用割合、又は(A) 成分と担体 との使用割合が上記範囲を追脱すると、活性が低下する ことがある。このようにして調製された本発明で用いる 重合触媒の平均粒径は、通常2~200µm、好ましく は10~150μm、特に好ましくは20~100μm であり、比表面様は、通常20~1000m³ /g、好 ましくは50~500m1/gである。平均粒径が2 u 血未満であると重合体中の微粉が増大することがあり、 200 μ mを超えると重合体中の粗大粒子が増大するこ とがある。此表面積が20m2/c未満であると活性が 低下することがあり、1000m2 /gを超えると重合 体の嵩密度が低下することがある。また、この重合触媒 において、担体100g中の連移金属量は、通常0.05 ~10g、特に0.1~2gであることが好ましい。運移 金属量が上記範囲外であると、活性が低くなることがあ る。このように担体に担持することによって工業的に有 利な高い警察所と優れた妨径分布を省するプロビレン系 意合体を得るととができる。

【0047】本発明のプロビレン系重合体は、前記重合 無媒の存在下、プロピレンを単独重合またはエチレン及 び炭素数4~20のα-オレフィンからなる群から選ば れた1種以上のモノマー(以下、コモノマーと記す。) と共重合させて得られたものであるが、炭素数4~20 のα-オレフィンとしては 例えばブチン-1、ベンテ ン-1、4-メチルーペンテン-1、3-メチループテ ン-1, ヘキセン-1, オクテン-1、デセン-1, ド デセンー1、テトラデセンー1、ヘキサデセンー1、オ クタデセンー1、エイコセンー1などが挙げられる。プ ロビレン系置合体中のコモノマー含有量は0~30モル %の範囲内で、射出成形体、押出し成形体、フィルム成 形体等の成形体に要求される物性に応じて決定される。 具体的な物性としては例えば、弾性率、衝撃強度、透明 性等であり、これちの物性値を要求される値とするため 上記範囲でコモノマー含有量を決定する。尚、コモノマ 一含省替の制御は、使用するコモノマーのプロビレンに 対する使用割合を変化させる定法により可能である。

【9948】本発明のプロビレン系重合体の製造方法に おいては、前記重台無線の存在下、プロビレンを単独で またはコモノマーと共に重合させるが、重合形式として は、回分式、連続式のいずれであってもよく、また、ス ラリー宣合法、気相重合法、塊状重合法、溶液重合法な どの中かち、任意の方法を採用することができる。プロ

ダム共重合体とブロック共重合体とがあり、ランダム共 重合体は、最初からプロビレンとコモノマーとを反応系 内に存在させて共重合させることにより得られる。-方、ブロック共重合体は、先ずプロビレンの単独重合を 行い、同一反応系内または、他の反応槽へ移送し、引き 続いてプロビレンとコモノマーとの共重台を行うことに より得られるが、この場合、共宣合部のプロピレン/コ モノマーのモル比は通常、99/1ないし40/60で あり、共重台体全体での単独重台部/共重台部の重量比 ック共重合体には、同一反応系内で、先ずプロビレンと コモノマーとの共産合を行い、引き続いてコモノマーの 使用比率を変更して共重合を行うことにより得られる、 ランダムブロック共産台も含まれる。プロック共重台体 の場合は、何れの構造であっても、コモノマーの含有量 が30モル%を超えない範囲で製造される。

73

【① 049】スラリー重合又は溶液重合を実施する場合 に使用する重合溶媒としては、例えばプロパン、ブタ ン、ベンタン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン、デカ タン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脳 で式炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳 看態炭化水素、エチレンクロリド、クロロベンゼン、ジ クロロメタン、クロロホルムなどのハロゲン化炭化水素 などが挙げられる。これらの密媒は単独で用いてもよ く、二種以上を混合して用いてもよい。重合条件につい ては、重合温度は、通常-50~200°C、好ましくは -20~150℃、より好ましくは0~120℃の範囲 である。重合圧力は、通常0~200kg/cm¹ G、 は0.2~100kg/cm; Gの範囲である。また、章 台時間は、通常 10秒~5時間、好ましくは30秒~ 3時間、より好ましくは1分~2時間の範囲である。さ らに、宣台触媒の使用量は、原料モノマー/前記(A) 成分モル比が、好ましくは1~10°、より好ましく1 (1)~10' となるように選ぶのが有利である。 1 o g M S ≥ 3.17×1 o g (n) - 9.68

の関係を満たし、かつ極限站度 [n]が6.1~15.0 デ シリトッル/女の範囲にあることが必要である。 【0052】10gMSが「3、17×10g(n)-0, 40 シリンダー経 68」の値より小さい場合には、溶験加工性に劣り、本 発明の目的が進せられない。恣酷加工性の面から、好き ! ogMS≥3.17×10g(η)-0.57 より好きしくほ

! ogMS≥3.17×1 og (η) -0.46 更に好きしくは ! ogMS≥3.17×1 og (η) -0.35

である。なお、前記落融張力MSは、東洋精機社製キャ ピログラフを用い、下記の条件で測定した値である。

*【0050】生成するプロピレン茶面合体の振開結度の 制御(分子費の制御)は 重合触媒の系成分の使用割合 や重合触媒の使用量、重合温度、重合圧力などを、前記 **経囲で適直返定することにより、行うことができる。ま** た。極限粘度の制御には、水素を添加することが常用さ れているが、本発明の方法においては水素を添加しない ことが好ましい。水素を添加すると、成形加工性が低下 することがある。本発明の方法で得られたプロビレン系 重合体はアタクチック、アイソタクチック、シンジオタ は通常、99/1ないし50/50である。また、プロ 10 クチックのいずれのものであってもよいが、特にアイソ タクチックのものが好きしい。このアイソタクチックブ ロビレン系置合体の場合、融点は通常80°C以上、好き しくは90℃以上、より好ましくは110℃以上、さち に好ましくは115~167℃の範囲である。なお、こ の融点は、下記の方法により測定した値である。すなわ ち、示差走査型熱量計 (セイコー電子工業 (株) 製、D SC200型]を用い、室温かち10℃/分の遮底で2 00°Cまで昇蓋し、200°Cで3分間保持したのち、1 0℃/分で30℃まで経療する。30℃で5分階保持し ン、ドデカン、灯袖などの脂肪疾炭化水素、シクロペン 26 たのち、10°C/分で昇温し、その際に現れる融解ビー クの温度を融点とする。とのプロピレン系章合体は、メ ルトインデックスMiがe.005~1000g/10分 の範囲にあるものが好ましい。このM I が 9、0 0 5 g/ 10分余満では溶融流動性が不充分であり、1000g /10分を超えると機械物性が著しく低下し、好ましく ない。溶融液動性及び機械物性のバランスなどの面か ち、より好ましいM | はe.0 1~800g/10分の範 聞であり、特に0.05~600g/10分の範囲が好ま 好ましくは9.1~150kg/cm⁴ G、より好ましく 39 5に準拠し、温度230°C、荷重2.16kgの条件で測 定した値である。

> 【0051】次に、このプロピレン系重合体は、温度2 30 YCにおいて測定した溶融張力MS(で)と チトラ リン治媒中、温度135°Cにおいて測定した福限拡度

〔n〕 (デシリットル/g) とが、式(1)

キャピラリー : 直径2.095mm, 長さ8.0 mm、流入角90度 : 9 0 mm シリンダー押出速度 : 10 mm/分 巻き取り速度 : 3.14 m/9 230℃

【0053】また、極限結度 (カ)が0.1 デシリットル / g 未満では溶験加工性に劣るとともに、機械的強度が 不充分であり、また15.0デシリットル/ cを超えると 溶融粘度が高く、溶融加工性が低下する。溶融加工性及 び機械的強度のバランスなどの面から、この〔ヵ〕とし ては、0.4~10.0デシリットル/8が好ましく、特に 50 5.6~6.0 デンリットル/8の範囲が好ましい。さら

(14)特開2000-95808 26

に、このプロビレン系重合体は、ゲルバーミエーション クロマトグラフィー (GPC) 法で測定したポリエチレ ン換算の重置平均分子置Mwと数平均分子置Mnとの此 Mw/Mnが、1.4~30の範囲にあるものが好まし Ļs.

[0054]

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳しく競 明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定さ れるものではない。

調製例1

シリカ担待メチルアルミノキサンのカーヘブタン影響液 の調製 SiO、 (ワジシリシア計製、商品名:P-10)27.

1gを200℃で2時間減圧軟模処理し、軟煤シリカ2 5,9gを得た。この乾燥シリカをドライアイス/メタノ ール浴で-78℃に冷却したトルエン400ミリリット ル中に投入し、撹拌しながら、これに1,5モル/リット ルのメチルアルミノキザントルエン溶液145.5ミリリ ットルを1.0時間かけて満下ロートにより適下した。こ の状態で4.0時間放置したのち、-7.8℃から2.0℃ま 20 製倒2と間機にしてシリカ組持メタロセン触媒3を調製 で6.0時間で昇温し、さらにこの状態で4.0時間放置し た。その後、20°Cから80°Cまで1,0時間で昇温し、 80°Cで4、0時間放置することにより、シリカとメチル アルミノキサンとの反応を完了させた。

【0055】との疑測液を60℃でる過し、得られた固 影物を60°Cにて、400ミリリットルのトルエンで2 回。さちに60°Cにて、400ミリリットルのn-ヘキ サンで2回洗浄を実施した。洗浄後の固形物を60℃で 4.0時間減圧乾燥処理することにより、シリカ狙持メチ ルアルミノキサン33.69gを得た。メチルアルミノキ 35 サンの相待者は23.12重量%であった。このようにし て得られたシリカ相待メチルアルミノキサン全量に、p ーヘブタンを削えて全容量を500ミリリットルとし、 メチルアルミノキサン濃度0.27モルノリットルの懸瀾 液を鋼製した。

[0056] 調製例2

シリカ担待メタロセン触媒 1 の調製

調製例1で得られたシリカ組締メチルアルミノキサン懸 棚腔7.41ミリリットル(メチルアルミノギサン2.0ミ リモル〉を、乾燥壅素置換容器に採取し、n-ヘプタン 40 20ミリリットルを加えて捌拌した。この影響液に、選 移金属化合物として、 rac-(1,2"-エチレン) (2、1'-エチレン)-ビス (インデニル) ハフニウ ムジクロリド (rac-Et, (ind), HfC 1、1のトルエン擦液2.0マイクロモル及びrac-ジ メチルシランジイルーピス-1~ (2-メチル-4、5 ーベンゾインデニル)ジルコニウムジクロリド [rac -Me, S: (2-Me-4, 5-Benzind), 2 r C l 。] のトルエン溶液2、0 マイクロモルを添加 し、室温で0.5時間撹拌した。その後、撹拌を停止し、

固体触媒成分を消除させ 消除した関体触媒成分が赤色 であり、溶液は無色透明であることを確認した。このよ うにして、シリカ担鈴メタロセン無媒 1 を調製した。 [0057] 網製例3

シリカ担待メタロセン触媒2の類製

調製例2において、rac-Me, Si (2-Me-4. 5-Benzind), 2rCl, の代わりに、r ac‐ジメチルシランジイルービス‐1‐(2‐メチル -4-フェニルインデニル)ジルコニウムジクロリド 19 (rac-Me, S: (2-Me-Phind), 2r C12] を用いた以外は、調製例2と同様にしてシリカ 担持メタロセン触媒2を調製した。

調製例4 シリカ担待メタロセン触媒3の順脳

顕鏡例2において、rac-Me, Si (2-Me-4、5-Benzind)。2rCl。の代わりに、r ac-(1, 2'-エチレン) (2, 1'-エチレン) -ビス {インデニル} ジルコニウムジクロリド (rac - Et, (ind), 2rCl,] を用いた以外は、額

[0058] 調製例5

シリカ担待メタロセン無媒4の調製

調製例2において、rac-Et, (Ind), HfC 12 の代わりに、 r a c - ジメチルシランジイルービス -1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)ハフニ ウムジクロリド (rac-Me, Si (2-Me-4-Ph Ind) 。HfCl。 Jを用い、かつrac-Me , Si (2-Me-4, 5-BenzInd), ZrC 1: の代わりに、rac-ジメチルシランジイル-ビス -1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)ジルコ ニウムジクロリド [rac-Me, Si(2-Me-4 Phind)、2rCl、)を用いた以外は、調製例 2と同様にしてシリカ担持メタロセン触媒4を調製し た。

晒紗倒6

シリカ担待メタロセン無媒5の顕製

12 の代わりに、すac‐ジメチルシランジイル‐ビス -1-(2-メチル-4、5-ベンゾインデニル)ハフ ニウムジクロリド [rac-Me, Si(2-Me-4、5-Benzind), HfCl, Jを用いた以外 は、関製例2と同様にしてシリカ担持メタロセン触媒5 を調整した。

調製例2において、rac-Et, (Ind), HfC

【0059】調製例7

シリカ相待メタロセン解媒合の顕影

調製例2において、rac-Et, (Ind), HfC 1、の代わりに rac-ジメチルシランジイルービス -1-(2-メチル-4、5-ベンゾインデニル)ハフ 50 ニウムジクロリド [rac-Me, Si(2-Me(15)

特闘2000-95868

4.5 - Benzind)、自fCl, 1を用い、かつ rac-Me, Sı (2-Me-4.5 - Benzin の)、2rCl, の代わりに、rac-ジメチルラン ジイル・ビス-1 - (2-メチル-4-フェンメインデ エル)ジルコンルシクロリド(rac-Me, S) (2-Me-4-Phind)、2rCl, 1を用いた 以対は、週間内と回標化にサリカ網をメロサリカ網を対して

媒6を顕製した。 顕越例8

シリカ担待メタロセン練練?の顕製 顕数例2において、連移金質化合物として、Fac‐ジ メチルシランジイルービス-1-(2-メチル-4,5 -ベンソインデエル)ジルコエウムジクロリド (Fac

- Me, S₁ (2-Me-4, 5-Benzind), 2rC!, 1のみを用いた以外は、調製例2と同様にしてシリカ担待メタロセン触媒7を顕製した。

[0060]調製例9

シリカ担待メタロセン無媒8の調製

源製例2において、運移金属化合物として、 raeージ メチルシランジルルーピスー1 - (2 - メチル-4 - 7 20 分間解われ、これに、誤製料2で課製したとりり力能性 メタロセンデェル)シルコニウムジウロリド (rae - メタロセン無線)を投入し、60 でまで昇風したのち、 Me、Si (2 - Me - 4 - Ph in d)、2 r C プロビレン7.0 k g / c mi でで連続が正常機し、2.0

1。)のみを用いた以外は、調製例2と同様にしてシリカ担持メタロセン無媒8を調製した。

調製例10

シリカ担待メタロセン触媒9の顕製

調製例2において、遷移金属化合物として、 r a c - (1、2 - エチレン) (2, 1 - エチレン) - ビス

(インデニル)ジルコニウムジクロリド(rac-Et ,(Ind)。ZrCl。)のみを用いた以外は、調料 30 例2と同様にしてシリカ担待メタロセン無駄9を調製し

[0061]調製例11

シリカ担待メタロセン触媒10の調製

ジリル田はススロセン歴: 1000mm 調製例1で得られたシリカ担待メチルアルミノキサン歴 類磁をメチルアルミッキウン相当での.8.3 リモル 起葉 重素酸機容器に採取した。これに乾燥窒素を磁気下、 ロ ヘブダン20 ミリリテルを加えて擦拌した。この層 類似、選移金製化合物として、 ra c ージメテルシランジイルービス 1 ー (2 ・メチル・4 つフェングン デンジイルービス 1 ー (2 ・メチル・4 つフェングン コープ・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージング・ロージングロージングロージングロージングロージングローグのフージングロージングローグのフェングロージングロージングローグのフ

【0062】実施例1

【0063】実施例2~7及び比較例1~3

実験例1において、第1表に示すシリカ担待メタロセン 触嫌を用い、第1表に示す反応条件にてプロピレンの重 台を行った。得られたボリプロピレンの評価結果を第1 表に示す。

[0064]

【表1】

29			(16) 38 1 表-	- 1	,		特開2000-95808 30
				長 傑			
1		シリカ社	目持メタロセン鮟鱇	医力	温度	9 5 商	
		接類	退移金属成分	ca ^r G)	(%)	(ar)	
	1	触媒1	A-1-Zr A-3-Hf	3. 0	6.0	2. 0	
寒	2	触媒 2	A - 2 - Z r A - 3 - H f	7, 0	7 0	1. 5	
施	3	触媒 3	A-3-Z r A-3-H f	7. 9	50	3. 0	
91	4	独媒 4	A - 2 - Z r A - 2 - H f	7. 0	6.0	2.0	
	5	触媒 5	A-1-Z r A-1-H f	7. 0	6 0	2. 0	
	6	龍城 6	A-2-Z r A-1-H I	7, 0	6 D	1, 5	
	7	独邸 6	A-2-2 r A-1-H f	7. D	70	1. 5	
灺	1	触媒?	A-1-2 :	7. 0	6.0	2. Q	
紋	2	触媒8	A - 2 - Z r	7. 0	6.0	2. 0	
(81)	3	触媒 9	A-3-2r	7, 0	5 0	3. 0	

[0065] (注)	
A-1-2:: rac-ジメチルシランジイルービス	
-1-(2-メチル-4、5-ベンゾインデニル)ジル	
コニウムジクロリド	
A-I-Hf: rac-ジメチルシランジイルービス	
-1-(2-メチル-4、5-ベンゾインデニル)ハフ	
ニウムジクロリド	
A-2-2:: Fac-ジメチルシランジイルービス	30
-1-(2-メチル・4-フェニルインデニル)ジルコ	
ニウムジクロリド	
A-2-Hf: Fac-ジメチルシランジイルービス	
-1-(2-メチル-4-フェニルインデニル)ハフニ	
ウムジクロリド	
A-3-2r: rac-(1, 2'-エチレン)	
(2、1 -エチレン) - ビス (インデニル) ジルコニ	
ウムジクロリド	
A-3-Hf: fac-(1, 2'-エチレン)	
(2、1 -エチレン) - ビス (インデニル) ハフニウ	40
ムジクロリド	

[0066] [表2]

	-	ボ	リブロ	8 h	ν
		収量	M I (g/10 /})	(n) (d1/s)	T m (°C)
	1	40.13	2. 0 9	2. 1 9	144.9
異	2	182. 3	0.48	2. 7 9	149. 1
严	8	16, 7	1. 6 1	2.08	185. 7
楚	4	229, 8	0. 7 7	2. 8 5	148. 3
婀	5	61.5	4.11	2.02	145. 7
19:3	6	68.8	0. 2 4	3. 0 1	148.0
	7	76.0	0, 0 2	2.80	148. 4
比	1	35. 4	4.11	2.02	145.8
較	2	192. 8	0.30	3. 2 4	147.6
例	3	15. 1	1.98	1.89	135. 6

第 1 表-2

(17)	特開2000-95808
	32

10分間この状態を保持した。次に反応温度を55℃と し、プロピレンを3、1 ノルマルリットル/分、エチレン をe.15ノルマルリットル/分の液量でオートクレーブ に流入させ、圧力が7.5 kg/cm² Gとなるよう調整 し、モノマーを流通させた。これに、調製例11で調製 したシリカ担持メタロセン触媒10を全置、触媒投入ラ インからオートクレープ内に導入し、共重合を開始し た。重合圧力、重合温度が設定値となるよう制御しつ つ、60分間重合を実施した後、モノマーの供給を停止 10 し、未反応ガスを脱圧により除去し、メタノールに反応 復合物を投入し、 ろ過により、プロビレン/エテレン共 重合体を回収した。乾燥後の共重合体の収置は115g であった。この共重合体の極限粘度 [n] は1.5 0 d] /g 融点Tmは135℃ メルトインデックスM!は 9.2g/10分、溶融張力MSは1.8gであり、NMR 解析で得られたエチレン含有量は1.5 モル%であった。 また、A=3,1710g(n)-0.68の値は-0.12

[0070] **機袢装置付き1,6リットルステンレス製耐圧オートクレ 20 【発明の効果】本発明によれば、溶熱張力が高く. 成形** 加工性に優れ、発泡成形、シート成形、ブロー成形など に適用でき、特に大型プロー成形や厚物発泡体などの成 形に好適に用いられるプロビレン系重合体を、安価に、 かつ効率よく製造することができる。

2であり、! ogMSは0.255であった。

		第	31 1 表-3			
		ポリプロピレン				
		MS (g)	logMS	A		
	1	2. 8	0.447	0.399		
	2	6. 5	0.813	0.733		
実	3	4.3	0.633	0.328		
施	4	5. 3	0.724	0. 6 6 2		
婀	5	2. 0	0.301	0.288		
89	6	8. 0	0.903	0.837		
	7	6, 8	0.820	0, 737		
比	1	0, 4	-0, 3 9 8	0, 2 8 8		
較	2	5. 4	0.732	0.938		
34	3	0, 6	-0.222	0.916		

[0068] (注] A=3.17×10g(η)-0.68 100691事締例8

ープを80℃に削熱し、充分に減圧軟繰したのち、乾燥 **盗素で大気圧に戻し、空温まで降温した。このオートク** レーブに、乾燥窒素雰囲気下、乾燥脳酸素したn-ヘキ サン400ミリリットルとトリイソプチルアルミニウム 0.5ミリモルを殺入し、500 r p mで保控を開始し、